

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 21 年 4 月 2 日 (2009.4.2)

【公開番号】特開 2007-234964 (P2007-234964A)
【公開日】平成 19 年 9 月 13 日 (2007.9.13)
【年通号数】公開・登録公報 2007-035
【出願番号】特願 2006-56412 (P2006-56412)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

H 0 1 L 21/308 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 4 5 Z

H 0 1 L 21/304 6 4 7 Z

H 0 1 L 21/308 E

【手続補正書】
【提出日】平成 21 年 2 月 17 日 (2009.2.17)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

オゾンにより表面に酸化膜が形成されたシリコンウエハを、アンモニア、水酸化テトラメチルアンモニウム、コリンのうちいずれか一種以上の薬品と過酸化水素との混合液で洗
浄することを特徴とする、シリコンウエハの洗浄方法。

【請求項 2】

前記酸化膜の初期厚さ未満の厚みの酸化膜をアンモニア、水酸化テトラメチルアンモニウム、コリンのうちいずれか一種以上の薬品と過酸化水素との混合液で洗浄してエッチン
グすることを特徴とする、シリコンウエハの洗浄方法。